電子線照射中における宇宙機用絶縁材料内部の空間電荷測定

本城正人*, 丸田真吾, 田中康寛, 高田達雄, 渡邉力夫 (武蔵工業大学)

Measurement of Space Charge in Electron Beam Irradiated Dielectric Materials for Spacecraft

Masato Honjoh, Shingo Maruta, Yasuhiro Tanaka, Tatuo Takada, Rikio Watanabe (Musashi Institute of Technology)

1. はじめに

人工衛星などの宇宙機は温度変化の激しい宇宙環境を飛 行するため、機内の温度を一定に保つ必要があり、ポリイ ミドなどの絶縁材料フィルムを積層したサーマルブランケ ット(MLI:Multilayer Insulation)と呼ばれる断熱材で覆われ ている。これらの絶縁材料フィルムは、宇宙環境、すなわ ちプラズマ環境や放射線環境下に曝されることで、内部に 電荷が蓄積し帯電する。帯電量が大きくなると放電事故が 発生し、絶縁材料の劣化や搭載されている機器の誤作動・ 故障を引き起こすといわれている。そのため、宇宙機の設 計にはポリイミドに代表される絶縁材料等の電気的特性が 重要な要因となる。しかし、現在検討されている宇宙機設 計のガイドラインでは、電子線などの高エネルギー粒子線 が照射された絶縁材料の電気的特性はほとんど考慮されて いない。

そこで本研究では、上述した宇宙機用絶縁材料内部で生 じる帯電現象(内部帯電)のメカニズムを解明するために、 絶縁材料内部の電荷分布を計測する装置を開発してきた。 また、真空チャンバーに設置した電子線照射装置を用いて 電子線照射環境を模擬し、空間電荷分布測定法として実績 のある圧力波法(PWP法)を用いて、真空環境における電 子線照射中の高分子絶縁材料内部に蓄積する空間電荷分布 測定を可能とした。これらの計測システムを用いて、これ まで、絶縁材料として MLI に最も多く使用されているポリ イミド(PI)および国際宇宙ステーション等で使用されて いるポリテトラフルオロエチレン(PTFE)に電子線を照射 し、照射中および照射後のリアルタイム内部帯電計測を行 ってきた。今回は、PI および PTFE に電子線を照射した際 に試料内部に蓄積する電荷量および電荷分布の違いについ て以下に報告する。

2. PWP 法测定原理

図1に PWP 法の測定原理図を示す。 圧電素子にパルス電 界 e(t)を印加することで発生する圧力波 p(t)は、電極内を伝 搬し、試料に到達する。図1に示すように内部に空間電荷 $\rho(z)$ が存在している誘電体試料中に圧力波が伝搬すると、 試料が厚み方向に微小に変位し、それにともない試料中に 分布している空間電荷も微小変位する。その結果、試料を 含む閉回路に変位電流 *i(t)*が流れる。この変位電流 *i(t)*を検 出することで試料内部の空間電荷分布の情報を得る。また、 この検出信号をアンプにより増幅し、オシロスコープで電 圧信号として検出する。その後、PC により適切な信号処理 を行うことで試料中の空間電荷分布を得ることができる。



3. 測定装置

<3-1. PWP 測定装置>

図2、3に PWP 測定装置の概略図および写真を示す。本 装置には、電子線を試料に照射するための直径 10mm の照 射孔が照射側電極に設置され、試料表面に蒸着されたアル ミ電極とともに、接地電極を構成している。また、下部電 極として石英ガラス上面に Cr-Ni を蒸着して、信号検出電 極として用いている。石英ガラスは、信号検出用の電極を 接地導体から絶縁するために用いている。なお、真空下で 試料と電極の密着性を高めるために、ガラス上面に溝を加 工し、試料と電極間の空気を排気する構造にしている。

この測定装置では厚さ4µmのPVDF(ポリフッ化ビニリデン)に、パルス幅 1nsec、電圧値 200V のパルス電圧を印加することで、幅 1nsec のパルス圧力波を発生させることができる。現在、本測定装置の位置分解能は約 6µm であり、厚さ50µm 程度以上の試料が測定可能となっている。





図3 測定装置写真

<3-2. 電子線照射用真空チャンバー>

図4に電子線照射用真空チャンバーの概略図、図5にチャンバーの写真を示す。電子線の照射には電子顕微鏡用の タングステンフィラメントを用い、加速エネルギー100keV までの電子線照射が可能であり、チャンバー内の真空度は 約10⁵Paまで到達可能である。



図4 電子線照射用真空チャンバー

4. 測定方法

測定に使用した試料は、厚さ約 125μm の PI フィルム (東 レ・デュポン社製、Kapton[®]-H) および、厚さ約 100μm の PTFE フィルムである。今回の実験は、真空度を約 10⁴Pa で 一定にし、加速エネルギー20~80keV、電流密度 20~ 160nA/cm²の範囲で測定を行った。なお電流密度は、あらか じめ下部電極のみに電子線を照射し、下部電極を介して流 れる電流を測定し、その測定値を下部電極の面積で除すこ とで算出した。測定時間は、PI においては、電子線照射中 20 分間、照射後 20 分間の合計 40 分間、PTFE においては 電子線照射中 80 分間、照射後 40 分間の合計 120 分間とし た。また、測定間隔はいずれの場合も 30 秒である。



5. 実験結果および考察

<5-1. 侵入深さの加速エネルギー依存性>

まず、電子線の電流密度を 80nA/cm²一定とし、照射エネ ルギーを 40,60,80keV と変化させた場合の、電荷分布の経時 変化を観測した。図 6 および 7-(a)(b)(c)に、各照射エネルギ ーの電子線を照射した際に観測された PI および PTFE 中の 電荷分布を示す。同図中、電子線は図の右側から照射して いる。





図6および7に示した結果より、電子線を照射すること により、いずれの場合も試料中に負電荷が蓄積することが わかる。ただし、その蓄積分布および蓄積過程には試料に より大きな差がある。PIにおいては、電子線照射開始後、 比較的短時間に、ある一定の深さまでほぼ一定の電荷密度 の負電荷が蓄積し、その後電子線照射中にもかかわらず、 蓄積量は減少に転じている。一方、PTFEにおいては、電子 線照射開始直後には電荷が蓄積せず、ある程度時間が経過 した後、蓄積する電荷量が増大する。また、その分布は明 確なピークを形成し、ピークよりも試料内部側はなだらか な分布を取る。ただし、加速エネルギーが 80kV の場合は、 2 つのピークを持つ分布となっている。

この照射エネルギーと電荷の進入深さの関係を図 8 に示 す。ここで示した進入深さとは、図 6 および 7 に示した PI と PTFE の電荷分布のうち、分布の最も左側(照射電極と 反対側)先端部分のエッジの位置を進入深さとして示した ものである。なお、PI,PTFE ともに、進入深さとして示した 電荷分布の先頭のエッジ位置(侵入深さ)は、照射時間が 経過してもある一定の位置にとどまり、同様の実験を数回 行った結果、各エネルギーにおいて進入深さは数µm 程度の ばらつきで同様の傾向を示した。さらに、図 8 には以下の (1)式に示す、フェーザーの実験式より算出した最大飛程の 計算値もあわせて示している。

 $\mathbf{R} = 407 \times \mathbf{T}^{1.38} \qquad \boldsymbol{\cdot} \quad \boldsymbol$

なお、(1)式で T は照射する電子のエネルギー[MeV]を示 している。ここで(1)式の R は単位が面積密度[mg/cm²]であ り、R を透過する物質の密度[mg/cm³]で除すことにより、最 大飛程を求めることができる。すなわち、この実験式自体 はアルミニウムを試料として電子の最大飛程を実験的に求 めた式であるが、図 8 に示した値は、今回の試料である PI および PTFE の密度を用いて換算したものである。この結 果、PI においては式(1)で算出された最大飛程と実験で得ら れた進入深さはよく一致しており、今回 PI 中で観測された 分布の先端位置が、いわゆる最大飛程に相当すると考えら れる。一方、PTFE では式(1)により算出された最大飛程と実 験で得られた進入深さには 10~20 μm 程度の差があり、計 算により得られた位置の方が、進入深さとして求めた位置 よりも、比較的浅い位置を示している。これは、電荷分布 における先端位置がいわゆる最大飛程を表していないと考 えられる。PTFE においては、蓄積する電荷量が時間経過と ともに増大し、それにともない試料内部の電界が増大する ので、蓄積量が多くなると、発生した電界により蓄積した 電荷が移動すると考えられる。すなわち、ピークよりも奥 に位置する電荷は、一旦試料内部に停滞した電荷が、発生 した電界により移動したことにより生じたものではないか と考えられるが、詳細については、今後検討する。





< 5-2. PI における蓄積電荷量の経時変化>

前節において電子線照射により PI 内に蓄積する電荷量が ー旦増加し、その後減少する傾向にあることを示した。こ の関係を明確にするため、図 9 に蓄積電荷量の経時変化を 示す。同図(a), (b)はそれぞれ、加速エネルギーが 40, 60 keV の際の、各照射電流密度における蓄積電荷量の経時変化を 示している。なお、蓄積電荷量は、図 6 に示した電荷分布 の測定結果より、蓄積した負電荷部分の波形を積分するこ とによって求めた量である。この結果より、蓄積電荷量は 照射電流密度が比較的小さい 20 nA/cm²の場合は、ある値で 飽和するが、それより大きな電流量の場合は、一旦増加し、 ピーク値を示した後、電子線照射中にもかかわらず、その 後は減少していることが分かる。また、40 nA/cm²以上の電 流密度の場合、電流密度によらず、蓄積電荷量がほぼ一定 の値に到達すると減少が始まる傾向を示している。すなわ ち、40 keV の場合は 0.25~0.3 mC/m²、60 keV の場合は 0.6 ~0.7 mC/m²の値に達すると、蓄積電荷量の減少が始まる。 さらに、電子線照射後は、いずれの場合も電荷蓄積量が減 少するが、電子線の電流密度が大きいほど、電子線照射後 の蓄積電荷量の減少も早い傾向にある。

< 5-3. PTFE における蓄積電荷量の経時変化>

図 10 に PTFE における蓄積電荷量の経時変化を示す。前 節の PI では、電子線照射中にある値に達すると、蓄積電荷 量が減少することを確認した。しかし、PTFE においては、 照射時間にともなって蓄積電荷量が増加することが図 10 か ら確認できる。

また図 10 より、照射開始直後はほとんど試料内部に電荷 は蓄積しないが、ある時間を境にして、急激に蓄積する電 荷量が急増していることがわかる。急激がはじまる時間は、 照射電流密度により異なるが、その時間をおおよそ見積も ったところ、照射電流密度が 40nA/cm²の場合約 45 分、 80nA/cm²の場合は約 20 分、500nA/cm²の場合が約 4 分とな っており、図 10 の(a)と(b)の比較からも明らかなように、照 射エネルギーが異なっても、その時間はさほど変わらない。 すなわち PTFE では、照射開始直後の蓄積量は PI よりも少 ないが、ある一定の電荷量の電子線を照射することで、電 荷を蓄える特徴をもつことになる。



< 5-4. 電子線照射による特性変化の確認実験>

PI において、電子線照射中にもかかわらず蓄積電荷量が 減少するということは、電子線の照射により試料の特性が 変化した可能性がある。このように、電子線照射により試 料の電荷蓄積に関する特性が変化する様子を確認するため に、以下の実験を行った。すなわち、電子線を20分間照射 し、その後、20分間短絡状態で保持した後に、さらに20 分間照射を行い、このサイクルを3回繰り返した。なお、 照射条件は、加速エネルギーを80keV、電流密度を20およ び160 nA/cm²とした。図11に実験結果を示す。図11の連 続照射実験によると、2回目,3回目の照射では、1回目と同 様の経時変化を示さず、照射回数を増やすほど試料内に蓄 積する負電荷は減少し、前回の照射ではそれぞれ、1回目,2 回目の照射終了時の状態を維持していることが明らかであ り、電子線照射により不可逆的な特性の変化が試料内に発 生していると考えられる。この原因については、今後検討 する予定である。



なお、本研究の一部は科研費基盤(c)(16560280)の支援を受けた実施された。 文献

- (1) 田中宏樹、田中康寛、冨田信之、高田達雄:電学論 A, Vol.121, No.2 pp143-148(2001)
- (2) 電気学会技術報告 第834号(2001)
- (3) 放射線取扱技術、日本原子力産業会議、p.138(H10年)